PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-069596

(43)Date of publication of application: 16.03.2001

(51)Int.CI.

H04R 19/01 H04R 31/00

(21)Application number : 11-238928

(22)Date of filing:

25.08.1999

(71)Applicant: HOSIDEN CORP

(72)Inventor:

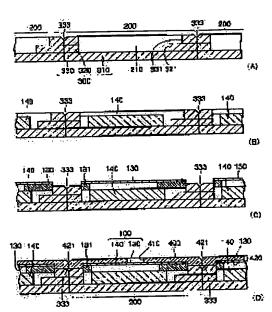
OBAYASHI YOSHIAKI

YASUDA MAMORU SAEKI SHINICHI OSAWA SHUJI

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR ELECTRET CONDENSER MICROPHONE AND THE SEMICONDUCTOR ELECTRET CONDENSER MICROPHONE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacture of a semiconductor electret condenser microphone that attains further miniaturization, enhances yield, reduces cost and facilitates its manufacturing. SOLUTION: This manufacturing method is a method for manufacturing a semiconductor electret condenser microphone, having a microphone section 100 that outputs a received sound as an electric signal and a case section 200 that contains this microphone section 100. This method includes a step, where a chip 140 with a fixed electrode formed thereto is assembled to a plurality of the case sections 200 formed as in-line arrangement to a sheet-like ceramic laminator 300, a step where a diaphragm 130 fitted to the chip 140 is assembled, a process clogging each case section 200 with a cover 400, and a step where the laminate 300 is divided into individual case section 200.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特期2001-69596

(P2001-69596A)

(43)公開日 平成13年3月16日(2001.3.16)

(51) Int.CL'

識別配号

FI

テーマコート*(参考)

H04R 19/01 31/00 H04R 19/01

5D021

31/00

C

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出顯番号

特顯平11-238928

(22)出顧日

平成11年8月25日(1999.8.25)

(71)出職人 000194918

ホシデン株式会社

大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号

(72)発明者 大林 義昭

大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号 ホ

シデン株式会社内

(72) 発明者 安田 馥

大阪府八港市北久宝寺1丁目4番33号 ホ

シデン株式会社内

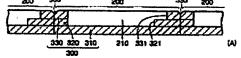
(74)代理人 100085938

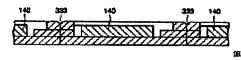
弁理士 大西 孝治 (外1名)

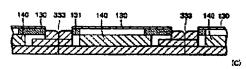
最終頁に絞く

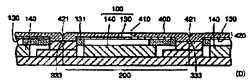
(57)【要約】 マイクロホン 【目的】 より小型化を達成することができ、歩智りも 向上し、コストダウンを図ることができ、しかも製造を 容易にする。

【構成】 入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部100と、このマイクロホン部100を収納するケース部200とを有する半塔体エレクトレットオンデンサマイクロホンの製造方法であって、シート状数個のケース部200に固定電優部110が形成された大変間のケース部200に固定電優にあられたでは、このチップ部140に取り付けられる振動限130を組み込む工程と、お記録をは300を個やのケース部200に分割する工程とを有している。









【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部と、このマイクロホン部を収納するケース部とを有する半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法において、シート状セラミックスの経層体に基盤目状に形成された複数個のケース部に、マ部を整部で開密する工程と、前記を程体を個々のケース部に分割する工程とを具備したことを特徴とする半年レクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法。

【諸求項 2】 前記マイクロホン部の構成要素を組み込む工程は、集験回路が形成されるとともに、固定電極部が形成されたチップ部をケース部に組み込む工程と、ケース部に組み込まれたチップ部に振動膜を取り付ける工程とに分かれていることを特徴とする諸求項 1 記載の半端体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法。

【請求項 3】 入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部と、このマイクロホン部を収納するケース部とを有する半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンであって、シート状セラミックスの経層体に基盤目状に形成された複数個のケース部にマイクロホン部の構成要素を組み込んだ後に、各ケース部を整部で開室し、その後前記接層体を個々のケース部に分割したことを特徴とする半導体エレクトレットコンデンサマイクロホン。

【請求項 4】 前記マイクロホン部の構成要素は、集積回路が形成されるとともに、固定電優部が形成されたチップ部と、このチップ部に取り付けられる振動膜とであることを特徴とする請求項 3記載の半導体エレクトレットコンデンサマイクロホン。

【発明の詳細な説明】

[0001]

「発明の原する技術分野】本発明は、半導体素子を形成する技術を応用した半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法と、この製造方法で製造された半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンとに関する。

[0002]

【従来の技術】この種の半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンは、図5に示すように、主として入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部70と、このマイクロホン部700と、このケース部800を開塞する整部810とから構成されている。

【0003】前記ケース部800には、後述するマイクロホン部700を保持するホルダ830等がある。 【0004】前記マイクロホン部700は、半導体素子を形成する技術を応用して構成されている。すなわち、このマイクロホン部700は、インピーダンス変換素子 や増幅素子等からなる集積回路が形成されたチップ部710と、このチップ部710の表面に形成された固定電極部720と、この固定電極部720の上に形成されたスペーサ730と、このスペーサ730に取り付けられて前記固定電極部720と一定の間隔を持って対向させられた振動限740とを有している。

【0005】このような半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンのマイクロホン部700製造工程は次の通りである。まず、ウエハに多数値の集接回路を形成する。集接回路が形成された側に固定電極部720を形成するとともに、スペーサ730を形成するとともに、スペーサ730を形成する。

成するとともに、スペーサ730を形成する。 【0006】次に、前記スペーサ730に振動膜740を取り付ける。すると、固定電極部720と振動膜74 0との間には、スペーサ730の厚さに相当する空間750が形成される。なお、振動膜740は予めリング741に結善されているとともに、上面にはエレクトレット層が形成されている。

【0007】ウエハに多数個形成されたマイクロホン部700は、ダンシングソーで分割される。この分割されたマイクロホン部700のチップ部710の裏 面側に端子760が取り付けられてマイクロホン部700として完成する。

【0008】このような構成されたマイクロホン部700は、セラミックス等からなるケース部800のホルダ部830に保持されるとともに、ホルダ部830の背面側に取り付けられたアース板820とともに、ケース本体部810の音孔811に正対される。

[0009]

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体 エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法は、入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部と、このマイクロホンを収納するケース部とを有いました。 マークロ・ボセラミックスの 経層体に基盤 はにおいて、シート状セラミックスの 経層体に基盤 に形成された複数 個のケース部に、マイクロホン部の様

成要素を組み込む工程と、各ケース部を蓋部で閉塞する 工程と、前記秩層体を個々のケース部に分割する工程と を有している。 - 【0012】

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施の形態に係る 半塚体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方 法の工程を示す板時的断面図、図2は本発明に係る半迭 体エレクトレットコンデンサッイクロホンの製造方法に だいてチップ部に振動膜を取り付ける前の板時ウンデン サマイクロホンの製造方法においてケース部にによる サマイクロホンの製造方法においてケース部ににより サマイクロホンの製造が上によってシークトレット・チャーク を取り付ける前の板時の平面と図4は本発明に係る 等体エレクトレット・チャース を取り付ける前の板時の平面と図4は本発明に修造が を取り付ける前の板時の下面と図4は本発明に修造が によって製造方面であまた によって製造のであまた。 「国図(A)は概略的平面 図、同図(B)は概略的人一 A線断面図、同図(C)は 低略的底面図である。

【0013】本発明の実施の形態に係る半導体エレクト レットコンデンサマイクロホンの製造方法は、入力され た音響を電気信号として出力するマイクロホン部100 と、このマイクロホン部100を収納するケース部20 口とを有する半導体エレクトレットコンデンサマイクロ ホンの製造方法であって、シート状セラミックスの秩層体300に基盤目状に形成された複数個のケース部20 Oに、マイクロホン部100の榕成要素として、集積回 路が形成されるとともに、固定電極部110が形成され たチップ部140と、このチップ部140に取り付けら れる振動膜130を組み込む工程と、各ケース部200 を蓋部400で閉塞する工程と、前記秩層体300を個 マのケース部200に分割する工程とを有している。 【0014】まず、ケース部200について説明する。 このケース部200は、図1等に示すように、3層のシ - ト状セラミックス310、320、330を結磨した 枝層体300に碁盤目状に形成されている。

【0015】各層のシート状セラミックス310、320、330には、同じ位置に複数個(図面では8つの食 通孔が開設されている。従って、枝層体300にも同様の貫通孔350A~350Hが形成されることになる。これらの貫通孔350A~350Hは、各層のシート状 フミックス310、320、330に形成された 学電 を相互に接続するための側面 楽電層(図示省略)が形成される部分である。

【0016】最下層のシート状セラミックス310は、ケース部200の底面となるものである。この最下層のシート状セラミックス310は、例えば358個のケース部200となるものであれば、縦が85mm、横が68.48mmに設定されている。なお、この最下層のシート状セラミックス310の上面側には、準電層312が全面的に形成されている。なお、この準電層312は、図3においては右上がりの斜線で示されている。ま

た、この最下層のシート状セラミックス310の表 面側には、図4(C)に示すように、前記側面導電層と繋がった4つの底面導電層315B、315C、315F、315Gが形成されている。

【ロロ17】このような最下層のシート状セラミックス 310の上に中間層のシート状セラミックス320が殺 層される。この中間層のシート状セラミックス320 は、大きさは最下層のシート状セラミックス310と同 ーであるが、368個の開口部321が形成されてい る。この開口部321は、中間層のシート状セラミック ス320が最下層のシート状セラミックス310に祛層 されることで、マイクロホン部100が嵌まり込む凹部 210となる部分である。 なお、この中間層のシート状 セラミックス320には後述する上層のシート状セラミ ックス310から露出する部分に3つの導電層322 A、3228、322Cが形成されている。 この導電層 322A、322B、322Cは、マイクロホン部10 0の電極141A、141B、141Cとポンディング ワイヤ150A、150B、150Cで接続される部分 である.

【0018】また、この中間層のシート状セラミックス320の上に、上層のシート状セラミックス330は、耐記開口部321より大きな368個の関口部331は、上層のシート状セラミックス部31は、上層のシート状セラミックス320に付着のシート状セラミックス320には、対しのでは一個では、1を露出させていることになる。また、この上層のシート状セラミックス330には、楽電層332が全面的に形成されている。

【0019】 このような3つのシート状セラミックス3 10、320、330を順次接層して焼成することで3 58個のケース部200が一体に形成された装層体30 0が構成されるのである。

【0020】なお、前記導電局322Aは、貫通孔350Cに形成された側面電極層(図示省時)に接続される。また、導電局322Bは、貫通孔350Bに形成された側面電極層(図示省時)に接続される。さらに、導電局322Cは、貫通孔350Aに形成された側面導電層(図示省時)、貫通孔350Gに形成された側面導電層(図示省時)、最下層のシート状セラミックス310に形成された準電層312及び、上層のシート状セラミックス330に形成された準電局332にそれぞれ接続されている。

【0021】 -方、ケース部200を閉率する蓋部400は、同様にシート状セラミックスを焼成したものである。 そして、前記凹部210に収納されることになるマイクロホン部200に音響を築くための音孔410が開設されている。この蓋部400も、ケース部300と同様に、1枚のシート状セラミックス420に368個形

成されている。

【0022】なお、前記ケース部200となる秩層体300と、蓋部400となる1枚のシート状セラミックス420とには、最終工程で個々の半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンに分割するための断面略V字形状のスナップライン333、421がそれぞれ形成されている。

【0023】ところで、前記マイクロホン部100は、 集核回路が形成されるとともに、固定電極部110が形 成されたチップ部140と、このチップ部140に取り 付けられる振動限130とを有している。

【0024】まず、前記チップ部140は、ウエハにフォトリソグラフィ技術等を用いて集残回路としてのインピーダンス変換素子、増幅回路、ノイズキャンセル回路、AGC回路等を形成することで、ウエハに多数個同時に形成される。さらに、図2に示すように、このチップ部140の上面に略任部110を取り囲むように4つのスペーサ120を形成する。なお、このスペーサ120を形成する。なお、このスペーサ120を形成する。なお、このスペーサ120を形成する。なお、このスペーサ120を形成する。なお、このスペーサ120を形成するものである。

【0025】このように多数個のチップ部140が形成されたウエハを分割して個々のチップ部140とする。【0026】このように、集枝回路等が形成されたチップ部140は、図1(B)に示すように、稜層体300に形成されたケース部200の凹部210に1つずつボンディングされる。そして、チップ部140の3つの電径141A、141B、141Cは、それぞれポンディングワイヤ150A、150B、150Cによって耐層のシート状セラミックス320の3つの導電322A、322B、322Cに電気的に接続される。

【0027】このようにチップ部140がボンディングされたならば、振動膜130を前記スペーサ120に取り付ける(図1(C)参照)。この振動膜130は、片面にニッケル又はアルミニウムの300~500人の窓書牒が形成されたEFPフィルムをリング131に貼るし、さらにコロナ分極の手法で-200~-250Vに帯電させることでエレクトレット層が形成されたものである。

【0028】上述のように構成された振動膜130をスペーサ120に取り付けた後、スクリーン印刷でケース部200に築電性接着剤を途布する。そして、図1 (D)に示すように、蓋部400となる1枚のシート状セラミックス420を経層体300に取り付けるのであ

【0029】すなわち、この製造方法では、秩層体300に形成された複数個のケース部200にマイクロホン部100を組み込む工程では、集検回路が形成されるとともに、固定電極部110が形成されたチップ部140をケース部200に組み込む工程と、ケース部200に

組み込まれたチップ部140に振動膜130を取り付ける工程とに分かれているのである。

【0030】このように複数個の半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンが形成されたものを前記スナップライン333、421から分割することで、図4に示すような個々の半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンとするのである。

【0031】なお、上述した実施の形態では、振動映130にエレクトレット層を形成したタイプを挙げたが、チップ部140にエレクトレット層を形成するタイプのものであってもよい。その場合には、振動映130に革電層を形成し、この導電層から信号をチップ部110の集接回路に挙くようにする必要がある。

【0032】また、1つの経層体300は368個のケース部200が集合したものとしたが、この数に限定されることはない。

[0033]

【発明の効果】本発明に係る半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法は、入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部と、このマイクロホン部を収納するケース部とを有する半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法であって、シートはフラミック、スの後層体に基盤目状に形成された複数個のケース部に、マイクロホン部の構成要素を組み込む工程と、もケース部を整部で閉塞する工程と、前記検摩体を個々のケース部に分割する工程とを有している。

体を個々のケース部に分割する工程とを有している。 【0034】この製造方法によると、ケース部、マイクロホン部を構成するチップ部、マイクロホン部を構成するチップ部、マイクロホン部を構成するを設立ができるので、従来の方法より小型化が図れるとともに歩留りを向上させ、コストの低減も図れるという効果がある。特に、複数角のケース部が形成された経層体にマグのクロホン部を組み込むようにするので、ハンドリングの面からも無理がなく動造が容易、特に自動化に有利になるという利点がある。

【0035】特に、前記マイクロホン部の構成要素を組み込む工程が、集終回路が形成されるとともに、固定電極部が形成されたチップ部をケース部に組み込む工程と、ケース部に組み込まれたチップ部に振動膜を取り付ける工程とに分かれていると、小さなチップ部に振動膜を取り付けるのではなく、大きなケース部に収納された状態のチップ部に振動膜を取り付けるようになるので、ハンドリングの面からも無理がない。

【0036】一方、本発明に係る半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンは、入力された音響を電気信号として出力するマイクロホン部と、このマイクロホン部を収納するケース部とを有する半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンであって、シート状セラミックスの検督体に基盤目状に形成された複数個のケース部にマイクロホン部の構成要素を組み込んだ後に、各ケース部

を蓋部で閉塞し、その後前記稜層体を個々のケース部に 分割しているので、小型化、コストダウン等を図ること ができる。

【0037】特に、マイクロホン部の構成要素を、集積回路が形成されるとともに、固定電極部が形成されたチップ部と、このチップ部に取り付けられる振動膜とすると、ハンドリングの面から有利であるのでコストダウンに有利である。

【図面の簡単な説明】

'n

【図1】本発明の実施の形態に係る半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法の工程を示す概略 的断面図である。

【図2】本発明に係る半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法においてチップ部に振動膜を取り付ける前の概略的平面図である。

図3】本発明に係る半導体エレクトレットコンデンサ

マイクロホンの製造方法においてケース部にチップ部を取り付ける前の概略的平面図である。

【図4】本発明に係る半端体エレクトレットコンデンサマイクロホンの製造方法によって製造された半導体エレクトレットコンデンサマイクロホンの図面であって、同図(A)は概略的平面図、同図(B)は概略的A-A線断面図、同図(C)は概略的底面図である。

【図5】従来のこの種の半導体エレクトレットコンデン サマイクロホンの概略的断面図である。

[符号の説明]

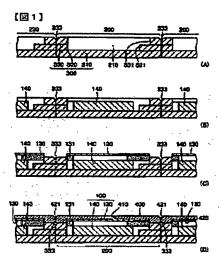
100 マイクロホン部

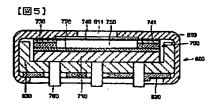
130 振動膜

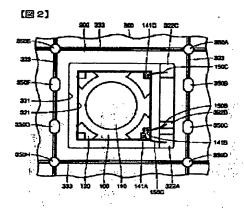
140 チップ部

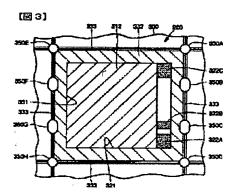
200 ケース部

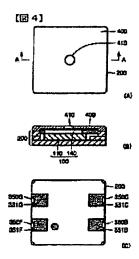
300 積層体











フロントペー ジの絞き

(72)発明者 佐伯 英一 大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号 ホ シデン株式会社内 (72)発明者 大澤 周治 大阪府八尾市北久宝寺1丁目4番33号 ホ シデン株式会社内 Fターム(参考) 50021 CC03 CC12